

**Adresse**

SUSS MicroTec AG  
Schleissheimer Str. 90  
D-85748 Garching  
Germany  
Telefon: (+)49 - 89 32 00 70  
Fax: (+)49 - 89 32 00 71 62  
E-Mail: [info@suss.com](mailto:info@suss.com)  
Web: [www.suss.com](http://www.suss.com)

**Kontaktperson**

Frau Brigitte WEHRMANN  
Marketing Communications Manager Lithografie  
Telefon: (+)49 - 89 32 00 72 37  
Fax: (+)49 - 89 32 00 71 62  
E-Mail: [brigitte.wehrmann@suss.com](mailto:brigitte.wehrmann@suss.com)

SUSS MicroTec ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Systemlösungen für die Mikro- und Nanostrukturierung, die in Märkten wie Nanotechnologie, MEMS, Advanced Packaging, Verbindungshalbleiter, Silicon-on-Insulator und 3D Integration eingesetzt werden. Das breite Produktspektrum umfasst komplette Prozesslinien zum Nanoimprinten, Belacken, Entwickeln und Reinigen, sowie Mask/Bond Aligner, Waferbond Anlagen und Testsysteme

Modifizierte Mask Aligner von SUSS MicroTec werden erfolgreich bei der kostengünstigen Replikation im Bereich Mikro- und Nanostrukturierung eingesetzt. Wie zum Beispiel der Nanoimprint Lithografie (NIL), einer Prägetechnik, bei der die Struktur mittels UV-Belichtung oder Wärmezufuhr durch einfachen Abdruck oder „Step and Repeat“ im Material fixiert wird.

SUSS MicroTec unterstützt im wesentlichen folgende Nanotechnologie-Anwendungen: UV-Nanoimprint Lithografie (UV-NIL), Substrate Conformal Imprint Lithografie (SCIL) und SMILE, einer Mikrolinsen Imprint Technologie.

UV-NIL und ihre verwandten Anwendungen sind kostengünstige Technologien zum Prägen von Strukturen kleiner 50nm, die einen höheren Durchsatz ermöglichen als hochauflösende Elektronenstrahl-Lithografie.

Die patentrechtlich geschützte SCIL Technologie schließt eine technische Lücke und erzielt auch bei großflächigen Nanoimprint Anwendungen eine exzellente Qualität bei der Strukturübertragung. SCIL wurde von Philips Research im niederländischen Eindhoven entwickelt. Die Nutzungsrechte wurden in Form einer Technologielizenz an SÜSS MicroTec übertragen.

Die Mikrolinsen Imprint Lithografie Methode SMILE ist dagegen hervorragend geeignet, um z.B. kosteneffizient CMOS Wafer-Level Kameras auf 8“ Wafern herstellen zu können. Unter Verwendung von UV-Replikation wird dabei ein flüssiges Polymer auf einem Wafer aufgebracht und unter Verwendung eines transparenten Stempels fixiert.